

13. 半導体

量産工程の受託から、研究開発・実験目的に至るまで、様々な用途に応じたイオン注入工程を受託しています。また、主要な物理分析の装置を備え、微細な形状の観察や故障解析等、様々な要望にお応えいたします。

300mm対応イオン注入装置

- ・ 研究開発のための小片サンプルから300mmウエハの量産請負まで、様々な用途に対応
- ・ 最大750keVまでの注入が可能
- ・ B、P、Asをはじめ、多種多様なイオン種に対応

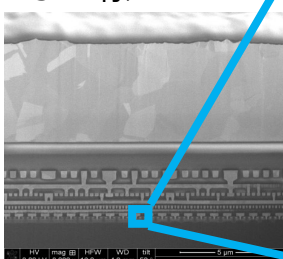


Siデバイスの断面観察

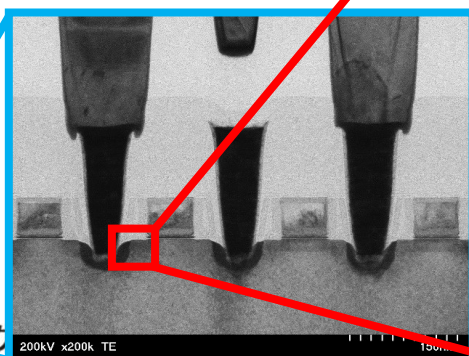
ナノオーダーの構造把握や格子像の観察を行います。また、TEM画像を使用した解析・評価、EDXによる局所的元素分析を行っております。



<SEM像>



<低倍率TEM像>



<高分解能TEM像>

